

MEMS技術 I

リソグラフィ

日時 平成30年6月22日(金) 13:00~17:00

場所 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(本部)
東京都江東区青海2-4-10

●ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前

●りんかい線「東京レポート」駅下車 徒歩15分 [朝夕無料送迎バスあり3分]
都営バス海01 テレコムセンター駅前下車

受講料 3,000円

『MEMS技術』の初心者の方へ

半導体製造やMEMSなどの電子産業においては、フォトリソグラフィを始めとして、電子ビームリソグラフィ(EBL)やナノインプリントリソグラフィ(NIL)などの微細パターン形成技術であるリソグラフィが用いられており、最先端の産業を支える根幹となっています。

本講習では、各種リソグラフィ技術について解説するとともに、実際の装置を用いてレジストを微細加工することで、リソグラフィ技術の理解を深めていきます。半導体・MEMS技術について知識を深めたい方や、都産技研のリソグラフィ設備の利用を検討している方の参加をお待ちしています。

MEMS技術II エッチングは、8月開催予定です。



マスコットキャラクター テリノ

定員

4名



時間	科目	講師
13:00~14:00	【講義】リソグラフィ フォトリソグラフィの基礎	東京都立産業技術研究センター 電気電子技術グループ 副主任研究員 山岡英彦 半導体微細加工、実装工程に関する技術支援、MEMSセンサ等の研究開発に従事。
14:00~17:00	【実習】リソグラフィ技術による微細構造の作製 ・スピンコーティング装置 ・紫外線露光装置、マスクレス露光装置 ・サンプル作製	東京都立産業技術研究センター 電気電子技術グループ 副主任研究員 山岡英彦 副主任研究員 小宮一毅 研究員 宮下惟人